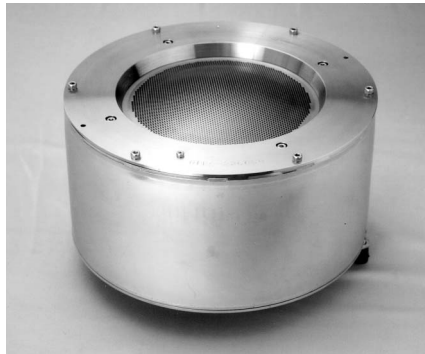


[優 秀 賞] IAD式光学薄膜成膜装置用大電流RFイオンソース

[技術経営特別賞] 株式会社 オプトラン

〒350-0801 埼玉県川越市竹野10-1

TEL.049(239)3381



イオンアシスト蒸着法（IAD方式）により生成される光学薄膜の結晶構造・組成などをイオン照射により制御することで、より高品質な光学薄膜の生成を可能にした大電流RFイオンソース。

最大電流2アンペア、最大電流密度は1平方センチメートル当たり100マイクロアンペアと高出力を実現することで成膜レートを向上。イオンソースの射出口を最適化することで照射領域の大面積化（直径1,600mm）と照射領域内でのイオン分布のばらつきを±数%以内に抑えたうえ、大型化により出力・照射面積などの性能アップを実現。